عوامل مؤثر بر ایجاد پوشش و کیفیت آن:

1- دانسیته جریان: هرچه دانسیته جریان کاتدی بیشتر باشد ضخامت پوشش بیشتر می‌شود (+)

2- اضافه پتانسیل کاتدی: (-)

3- غلظت الکترولیت: ممکن است غلیظ و رقیق باشد در این صورت میزان جریان فرق می‌کند (C)

4- دما: معمولاً با افزایش دما راکشن تسریع می‌شود (+)

5- هم زدن: با هم زدن غلظت یکنواخت می‌شود

6- زمان پوشش: هرچه زمان بیشتر باشد ضخامت بیشتر می‌شود (+)

7- فاصله بین آند و کاتد (-)

کاتدی که قطعه را به آن وصل می‌کنیم و جریان کاتدی می‌دهد و باعث ایجاد پوشش می‌شود

$M^+ + e \rightarrow M$

$H^+ + e \rightarrow \frac{1}{2}H_2$

M^+ از الکترولیت تغذیه می‌شود و در اثر عبور جریان کم می‌شود

محلول‌هایی که استفاده می‌کنیم از نظر PH یا اسیدی، الکالیایی و خنثی طبقه‌بندی می‌شوند محلول Base محلول الکترولیت اسیدی خواهد بود. مثل کلرورها، سولفات‌ها و سیانورها که نظر شما این محلول PH<7 است.

در سطح کاتد واکنش کاهش اتفاق می‌افتد اصلی تشکیل پوشش است. این واکنش توسط انجام می‌شود.

- اگر شیب روی قطعه زیاد باشد نمی‌تواند لایه سطح کاتد آزاد شود و باعث می‌شود پوشش روی سطح ایجاد شود

شیب روی قطعه به صورت لبه یا شعله چون لایه‌ی نازکی دارد و ضخامت پوشش

پوشش روی شیب روی قطعه نازک‌تر است چون لایه‌ی ضخامت دارد و راحت

گذر می‌کند و ولتاژ الکترولیت می‌شود. سطح قطعه باید هیدروژن آزاد شود

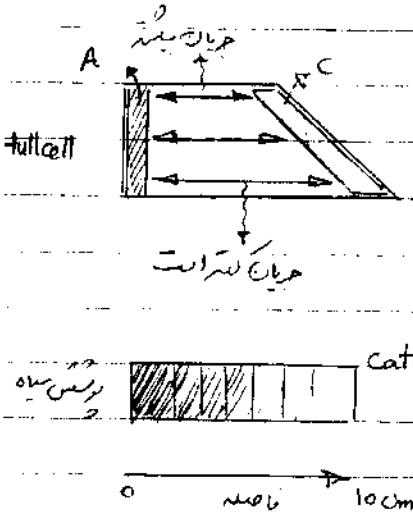
آندهای نامحلول با پایه‌ای اتم‌های نیز تولید می‌کنند پوشش متصل می‌شود.

عمل هم زدن می‌تواند از تولید هیدروژن جلوگیری کند

Polarization or over voltage هم زدن باعث کاهش دارد. اگر سدیم وضع شود هیدروژن با شدت بیشتر خواهد بود.

حالا با دانستن جریان لازم است برای اینکه پوشش را ایجاد کنیم و چه پتانسیلی اعمال کنیم. برای ضعف کردن آن از یک وسیله مخصوص استفاده می‌کنند که به آن Hull cell می‌گویند

یک cell استاندارد است که شرایط به جریان و پتانسیل را هم می‌دهد آند و کاتد را به صورت شیب قرار می‌دهند. تفاوت برای اینکه پوشش کنواخت باشد باید در هم صد نقطه تفاوت بیشتر باشد. اما در اینجا فاصله متغیر است. Hull cell را استاندارد از نظر حجم الکترولیت هم استاندارد جریانی که دارد می‌کنیم هر چه استاد و استهای کاتد هم زده شود جریان آن‌ها بیشتر خواهد بود. وقتی پوشش ایجاد شد آن قطعه را نقاشی کنیم می‌فهمیم که کدام قسمت‌ها پوشش ضخامت و سیاه شده یعنی در آن نقاط پوشش ما مناسب است و کیفیت



S.A...

www.iran-mavad.com
مرجع مهندسی مواد و متالورژی

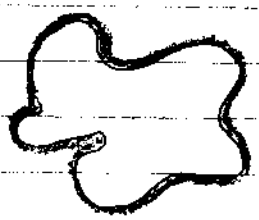
اصلاً پوشش داده نمی شود یعنی اصلاً پوشش گذاشته نمی شود از سیاه سیاه یا روشن پوشش بکار می بینیم که ترک نداشته
شخص پوشش خیلی خوبی ایجاد نشده یک نقطه ای وجود دارد که شدت جریان زیاد است که از روی آن داریم جریان
بهتر را بدست می آوریم یعنی ما با استفاده از سعی و خطا جریان را بدست می آوریم که از روی آن داریم بکار بست Hullcell را انجام
دهیم. یعنی اگر ترجیح Handbook نداشتیم شروع به آزمایش بدست آمدن برای پیدا کردن ناحیه و دانسیته جریان
بهینه می کنیم استرولیت محلول نیکل نیز پوشش است. برای ایجاد پوشش های کروم از اسید کرومیک استفاده می شود
برای پوشش Ni از محلول سولفات نیکل یا کلرید نیکل استفاده می شود. برای مس از سولفات مس ....
نیکل های سفید است سیانوری هم دارند که بسیار سمی است بهمین دلیل آزمایش های الکتریکی دوست ندارند خارج
از منطقه مسکونی انجام می دهند. اسید کرومیک هم خورنده است.
آندی می تواند از یک فلز خالص تشکیل شده باشد. مثلاً ترکیبات سولفاتی انتخاب Pb مناسب است چون با ترکیب
سولفات حل نمی شود همین فرایند باعث تمیز شدن و درآمدن کرایت الکتریکی خوبی داده و می تواند شسته شده است
آندی حل شود الکترولیت به وجود می کند و پوشش ناخالص می شود مثلاً پوشش Zn با آندیت هم داده نامطلوب است.
هرچه زمان را بیشتر کنیم، یعنی ضخامت پوشش بیشتری می شود یک رابطه ای بین ایجاد کنیم مثلاً رابطه exp یا توانی
بعد از مدتی بعضی از ترک ها خورده می شوند زمان را بیشتر کنیم.
با افزایش زمان الکترولیت ناپذیر می شود. یعنی کیفیت پوشش مانند 5 دقیقه اول با 5 دقیقه
دوم متفاوت است. اگر قطعه اول را وزن کنیم و قطعه دوم را وزن کنیم تغییر مقاومت قطعه اول بیشتر است. این مسئله
را هم باید در نظر گیریم. برای اینکه مقاومت پیدا نکند داریم دوز پوشش وجود دارد. است کنترل ضخامت هم سازه
است. مقداری از الکترولیت را می داریم از روی شیمی تر منطقه آن را بدست می کنیم (تیتر می کنیم). اگر کم بود
۱- روش اول این است الکترولیت جدید به آن اضافه کنیم این روش مقرون است چون مرتباً باید نمونه بگیریم.
۲- معایب آندی که غیر قابل حل است از آند قابل حل استفاده کنیم یعنی فرآیندی آندی انتخاب
می کنیم که از جنس پوشش باشد مثلاً اگر خواهیم پوشش Ni ایجاد کنیم از آند Ni خالص استفاده می کنیم.
یعنی مقداری که از پوشش حل می شود از حل شدن آند جبران می شود.
عامل تعیین کننده است هرچه دمای تر بود پوشش دهی سریعتر می شود منتها کنترل دما و فرایند مشکل می شود
دمای دما بالای بود تغییر محلول را داریم. منطقه تغییر دمای بهینه داریم که محاسبه می کنیم.
عامل دیگر ترکیب و محیط های خنثی، اسیدی، بازی خنثی بودنشان را کنترل می کنیم.
این شکلی از Electroplate cell ساده بود که توان می خواهیم تهیه کنیم پوشش ایجاد کنیم. اما برای پوشش
دهی آندی سیار متداول است. مثلاً آندی مرکب و مرغوب طلا با آندی طلا Pt که سیار بصرفه است
الکترولیت مخلوطی از نمک های پوشش دهنده است. حتی پوشش دهی آندی سه فازی و چهار فازی هم داریم
مثلاً برنز Zn و Cu و Sn نمک است که می کنیم استخراج کنیم که فصل اول مفرغ است برنز
می کند و حالی که ما می خواهیم با کیفیت خوب و مرغوب تهیه کنیم. این روش ها عادی نمی توانیم انجام
دهیم انجام دهیم باید طریق پتانسیل Cu و Zn را هم نزدیک کنیم یعنی ۰٫۱ ولت یا ۰٫۵ نزدیک کنیم از
محلول هایی که می نام Complex کننده استفاده می کنند پتانسیل را تغییر می دهد مثلاً آندی برنز
آندی با آندی آندی متداول است برای آندی هم داریم دقت Brass همان ترکیبی است که می خواهیم

s.a.m

www.iran-mavad.com
مرجع مهندسی مواد و متالورژی

اگر بخواهیم یک سطح آینه ای یا بسیار براق داشته باشیم باید دقت کنیم که آن سطح هیچ زبری یا عیب و ایرادی نداشته باشد (مثل لوله پوشش) بعد از پوشش هم همین صورت میشود. چون پوشش ها معمولا چند لایه هستند و ضخامت پوشش هم بسیار کم است و اثر سطح براق نمیماند برای اینکار از معدن های براق کننده (Brightener) استفاده میکنند که معمولا Base آن ها ترکیبات نیکل است که خواص ترکیبات شیمیایی مثل ساکارین را دارد. این براق کننده ها با واکنش ترکیب شیمیایی پوشش میشوند و همین دلیل براق و شفاف تر و شفاف تر است چون نمیخواهد دانه های رسوب کرده پوشش را خراب کند. پوشش کروم براق تر از پوشش کروم مات است. بنابراین حساسیت خوردگی پوشش های براق هم بیشتر است.

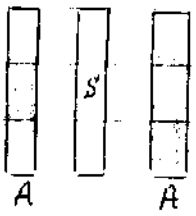
اگر یک قطعه مانند شکل روبرو داشته باشیم و بخواهیم آن را با پوشش کادمیوم پوشش دهیم



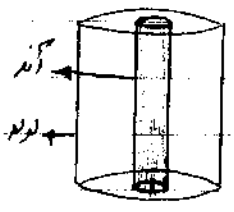
می بینیم قوس ها و برآمدگی ها آند کمتری نسبت به قسمت های داخلی خواهند داشت. بنابراین ضخامت پوشش قسمت های برآمده کمتر از قسمت های داخلی خواهد بود. ضخامت پوشش قسمت های فرورفته بیشتر از قسمت های برجسته است. پس پوشش ما غیریکنواخت میشود. برای اینکه پوشش یکنواخت بتوانیم ایجاد کنیم باید اضافه پتانسیل لازم سر جای خود تأثیر ناصحیح را از سر راه برداریم و دانسیته جریان یکنواخت شود. برای اینکار از مواد تسطیح کننده استفاده میکنند. با غلظت های مختلف بسته به شرایط آن را اضافه میکنند

اگر بخواهیم روی پلاستیک یا چوب پوشش دهیم باید ابتدا هادی باشد تا بتوانیم آن را پوشش دهیم. اگر نباشد نمی توانیم حتما اگر بخواهیم روی پلاستیک یا چوب پوشش دهیم باید ابتدا هادی باشد تا بتوانیم آن را پوشش دهیم. اگر نباشد نمی توانیم حتما اگر بخواهیم روی پلاستیک یا چوب یک لایه نازک ایجاد کنیم امکان پذیر است حتی روی شیشه هم می توانیم پوشش ایجاد کنیم اما هر کدام شرایط خاص خودشان را دارند. امروزه قطعات الکترونیکی که سبک هستند قسمتی پوشش Ni و Cr دارند. حتی frame های رادیو تلویزیون اینگونه هستند.

در مورد لوله های توخالی مثل لوله، اگر بخواهیم داخل لوله را پوشش دهیم باید کاری کنیم که آند داخل لوله قرار گیرد تا پوشش شود اگر لوله کوتاه باشد مشکلی ندارد. باید توجه کنیم در این روش ما فقط سطوحی را می توانیم پوشش دهیم که نزدیک آند هستند. اگر بخواهیم دو سطح یک آند را پوشش دهیم باید دو تا آند استفاده کنیم یک آند را بین دو جسم و آن را بیشتر آن قرار دهیم. البته استثنا نیست که اگر یک آند تخت را وسط هم نقطه یک طرف ورق پوشش بدهند. هر دو طرف پوشش می گیرند اما کیفیت آن ها با هم متفاوت می شود.



به کارخانه ها برای تعداد زیاد ورق ها، بصورت یکی در میان آند و کاتد را آند کاتد را قرار می دهند، یعنی تعداد آند ها بیشتر از کاتد ها می شود.



در مورد لوله ها یا قطعات توخالی، طراحی هایی که انجام می شود به این صورت است که آند را وسط لوله قرار می دهند که می تواند دور تا دور لوله را پوشش دهد.

در مورد قطعات کوچک مثل پیچ و مهره و سنجاق و... اگر بخواهیم با تعداد حجم زیاد پوشش دهیم از روش Barrel یا بشکه ای استفاده می کنیم. یعنی شکل هایی که سه بعدی هستند و این قطعات را درون آن می ریزند و این شکل درون الکترولیت حرکت می کند. جریان الکتریکی از طریق کنتاکت ها وارد شکل می شود و چون درون بشکه الکترولیت است جریان به قطعات می رسد و خیلی راحت پوشش داده می شوند.

www.iran-mavad.com
مرجع مهندسی مواد و متالورژی

- گاهی اوقات از سدیم‌های فلزی هم استفاده می‌کنند. یعنی قطعات را داخل سدیم قرار می‌دهند و سدیم را روی الکترولیت

روش Electroless :

در این روش منبع تأمین الکترون با آنکاری الکتریکی متفاوت است. در اینجا اصلاً جریان الکتریکی نداریم. اما به هر حال همون یون مورد نظر را احیا می‌شود با یک ترکیب که در یک جایی تأمین کنیم.

در این روش ترکیباتی که با الکترولیت اضافه می‌کنیم به نام ترکیبات احیا کننده. کار آن‌ها تأمین الکترون است، چون پوشش می‌شود. روش Electroless را برای همه فلزات نمی‌توان بکار برد. در روش آنکاری الکتریکی نوع فلز مقاومت نمی‌کرد هر فلزی را می‌توانیم ایجاد کنیم، اما در اینجا به روش‌های محدودی می‌توانیم ایجاد کنیم.

- معروف‌ترین پوشش Electroless پوشش Ni است. چون کاربردی صنعتی زیادی دارد.
- روش الکترولس را می‌توانیم برای فلزاتی مثل Pd / Cu / Zn / Au / Ag (یا پاریم) بکار ببریم.
- همراه محلول الکترولیت، یکسری مواد تشریح کننده و مواد پایدار کننده... هم اضافه می‌کنیم.
- حسن این روش این است که آن قسمت‌هایی که سطح فرورفتگی دارد شیار عمیق داشته باشد در آنکاری الکتریکی پوشش است.

- پوشش‌هایی که در Electroless می‌توانیم ایجاد کنیم پوشش‌های بسیار نازک است. در حد 3 تا 12 میکرون
- پوشش‌های بسیار یکنواخت است از آنکاری الکتریکی پوشش‌های بهتری است
- عمدتاً پوشش‌های الکترولس را برای ایجاد زیرلایه پوشش‌های دیگر استفاده می‌کنند.
- در مورد Ni که بیشترین کاربرد را دارد مواد دیگری که همراه Ni اضافه می‌کنند را نام می‌بریم. منبع تأمین یون Ni، سولفات نیکل و کلرید Ni است. یون احیا کننده‌ای که استفاده شده هیپوفسفیت سدیم است با ترکیب شدن با ترکیب Complex کننده آلی نیک اضافه می‌شود ترکیب به وجود آورنده نیک‌های سدیم هستند یک تثبیت کننده ترکیب فلوراید است. یک ترکیب بافر کننده که ترکیبات سولفوری هستند. یک ترکیب ترکننده که استرانیل است که سطح را آماده می‌کند برای اینکه پوشش انجام شود. متعادل کننده برای کنترل حباب‌های هیدروژن روی سطح نیز است که اسید سیتریک یا اسید گلیکولیک است. یک براق کننده هم اضافه می‌کنند.
- دمای حمام که پوشش‌ها ایجاد می‌کند بین 60 تا 95 است پوشش‌های آنکاری الکتریکی است
- موادی که آنکاری می‌کنیم در روش Electroless بعد است بیشتر از موادی است که در آنکاری الکتریکی آنکاری می‌کردیم و روش گران‌قیمتی است چون موادی که آنکاری می‌کنیم گران قیمت هستند.

قسمت این روش‌ها برای ایجاد یک لایه نازک جهت زیرلایه‌ها برای پوشش‌های بعدی بدون استفاده از جریان الکتریکی استفاده می‌شود. در مواقع برای مواد غیر فلزی کاربرد دارد. یعنی پلاستیک‌ها را اول از روش الکترولس استفاده می‌کنیم و بعد آنکاری الکتریکی. در اینجا نقاط ورود مواد را از اول شکل زیرلایه به صورت electroless در پلاستیک می‌کنیم

- اولین مرحله etch کردن سطح برای ایجاد تخلخل است. پس پلاستیک را در محلول اسید سولفوریک در دمای محیط etch می‌کنیم به مدت چند دقیقه. اسید سولفوریک حدود 25٪. بعد شستشو می‌دهیم.

سپس وارد محلول کلرور پالادیم می‌کنند که محلول بسیار گران قیمتی است. در این مرحله ذرات پالادیم در میان تخلخل‌هایی که در اثر etch کردن ایجاد کرده‌ایم قرار می‌گیرند. اگر کلرور پالادیم در دسترس نبود از کلرور قلع هم

S.a.m

www.iran-mavad.com
مرجع مهندسی مواد و متالورژی

می‌توان استفاده کرد که از آن جمله است. این ذرات پس از برخورد با سطح قطعه کار، انرژی خود را از دست داده و در سطح قطعه کار جذب می‌شوند. حال این قطعه کار در درون محلول سولفات مس قرار می‌گیرد بطوریکه عدد min 1 بر روی سطح یک لایه مس به ضخامت یک میکرون ایجاد می‌شود. پس از زمان مشخص شده، قطعه کار از محلول خارج شده و با آب شستشو داده می‌شود. حال با استفاده از یک منبع تغذیه DC، قطعه کار را به قطب منفی و یک تکه مس را به قطب مثبت منبع تغذیه وصل می‌کنیم. حال با استفاده از یک اسفنج آغشته به محلول الکترولیت مس، قطعه کار را به مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه مس اندود می‌کنیم. بدین ترتیب یک پوشش مس بر روی قطعه کار ایجاد می‌شود.

سومین روش مهم و پرکاربرد، روش رسوب‌دهی فیزیکی بخار (PVD) است که در این روش ما قطعه کار را در محفظه خلأ قرار می‌دهیم و سپس با استفاده از روش‌های مختلف، ماده پوشش را به صورت اتمی از منبع جدا کرده و بر روی قطعه کار می‌نشانیم. این روش‌ها را در ادامه توضیح می‌دهیم.

روش ایجاد پوشش در خلأ (Vacuum Coating):

در این روش‌ها، ابتدا قطعه کار را درون یک Reactor (نیز Reactor دارای دمای بالا) با حرارت دهی مقدار کمی از گاز مورد نظر وارد Reactor کرده و سپس با استفاده از پمپ‌های مکانیکی و روتاری، گاز را از Reactor خارج می‌کنیم. این کار را چند بار تکرار می‌کنیم تا فشار داخل Reactor به حدود 10^{-3} تا 10^{-6} میلی‌بار برسد. سپس با استفاده از روش‌های مختلف، ماده پوشش را به صورت اتمی از منبع جدا کرده و بر روی قطعه کار می‌نشانیم. این روش‌ها را در ادامه توضیح می‌دهیم.

روش PVD (Physical Vapor Deposition) ← با استفاده از تبخیر فیزیکی - دمای کمتر تا 500°C

روش CVD (Chemical Vapor Deposition) ← با استفاده از تبخیر شیمیایی - دمای بالا

پوشش‌های ایجاد شده از این طریق، سخت‌تر و مقاوم‌تر در برابر سایش بوده و ضخامت آن‌ها در حدود ۱ تا ۱۰ میکرون است. نازک‌ترین پوشش‌ها با روش CVD ایجاد می‌شوند و ضخامت آن‌ها در حدود ۰.۱ میکرون است. ضخیم‌ترین پوشش‌ها با روش PVD ایجاد می‌شوند و ضخامت آن‌ها در حدود ۱۰ میکرون است.

- پوشش زرد رنگ TiN (نیترید تیتانیوم) که مقاومت به سایش خیلی بالایی دارد.
- پوشش خاکستری رنگ TiC (کربید تیتانیوم).
- پوشش TiCN که ترکیبی از دو پوشش قبلی است و خواص هر دو را تا حدی دارد.

www.iran-mavad.com
مرجع مهندسی مواد و متالورژی